



平成 24 年 12 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社日立ハイテクノロジーズ
代 表 者 執行役社長 久田 眞佐男
本社所在地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
コード番号 8036 (東証・大証第一部)
問い合わせ先 コーポレート・コミュニケーション部 部長
加藤 弘之 (電話：03-3504-5138)

エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社の株式取得（子会社化）に関する
株式譲渡契約締結のお知らせ

株式会社日立ハイテクノロジーズ（執行役社長：久田 眞佐男／以下、日立ハイテク）は、平成24年5月24日付け「エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社の株式の取得（子会社化）に関する基本合意書締結のお知らせ」にてご案内のとおり、セイコーインスツル株式会社（代表取締役社長：鎌田 國雄／以下、SII）との間で、SIIの100%子会社であるエスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社（代表取締役社長：川崎 賢司／以下、SII ナノテク）の全株式を譲り受け、SIIナノテクを日立ハイテクの100%子会社とすることについて基本合意しています。

本株式譲渡契約の締結については、当局からの独占禁止法にかかわる審査が継続中のため、当初予定していた平成24年7月25日より延期する旨を公表していましたが、平成24年12月10日に当局から「排除措置命令を行わない旨の通知書」を受領しました。その後、平成25年1月1日付の株式譲渡完了に向けて協議を継続してまいりました結果、このたび、SIIナノテク株式取得による子会社化について最終的に合意し、本日開催しました各社の取締役会にて承認のうえ、株式譲渡契約を締結しましたので、お知らせします。

1. 株式取得の理由

日立ハイテクは、自らが有する世界トップレベルの技術、グローバルな営業力・ネットワークを活かした事業を展開し、「ハイテク・ソリューション事業におけるグローバルトップを目指します」という企業ビジョンのもと、当社グループの長期経営戦略である CS11 (Corporate Strategy 2011) を策定し、成長分野への積極的な事業展開を推進しています。その中で、自社製品部門の一つである科学・医用システム事業の成長戦略として、①コア技術強化・拡充、②新市場・成長市場への参入、③汎用分析装置の競争力・ラインナップ強化を掲げております。

一方、SII ナノテクは、「独自の技術を追求し、その技術でお客様の課題を解決し、企業と社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、分析・計測装置等の先端分野において競争力のある製品の開発・製造・販売を推進してきた企業であります。

SII ナノテクの事業は、当社事業との親和性、補完性が高く、当社としては、SII ナノテクの 100%子会社化により X 線、熱分析、イオン光学、物理計測技術などのコア技術および製品ラインナップの拡充、事業ポートフォリオの強化が見込めると考えております。

今後は、科学・医用システムの製造・販売・サービスにおいてシナジーを創出し、最先端アプリケーションの投入により、さらなる競争力強化と新市場・成長市場への参入を目指してまいります。

2. 本株式取得（子会社化）の目的

本子会社化の目的は、日立ハイテクの基盤事業の一つである科学機器事業のポートフォリオを抜本的に強化することにより、科学機器分野における総合メーカーとして安定的収益基盤を確立すること、また、日立ハイテクが持つ電子線・光学分析技術に、SII ナノテクの持つX線、熱分析、イオン光学、物理計測のコア技術を加えることで、環境・新エネルギー・ライフサイエンス等の成長分野での顧客ニーズに対応した、分析・検査ソリューションを拡充することです。

SII ナノテクは、以下のような観点で日立ハイテクの戦略の方向性と強く合致すると認識しております。

(1) 日立ハイテク既存製品群とSII ナノテク製品群との補完性

日立ハイテクの有機・無機分析分野における液体クロマトグラフ・分光光度計・原子吸光光度計の強みとSII ナノテクの熱分析装置・ICP 発光分光分析・蛍光X線分析装置・走査型プローブ顕微鏡の強みを補完。

(2) 日立ハイテクの販売ネットワークを用いたSII ナノテク製品のグローバル展開

日立ハイテクの国内 23 拠点、海外 26 カ国 58 拠点の販売網を活用し、市場プレゼンスの強化に注力しているアジアベルト*を中心に、SII ナノテク製品の販売を拡大。両社製品群の相互補完によるラインナップの強化およびメンテナンス体制の共通化により営業力を強化。

*日本からアラビア半島にいたるその間のアジア沿岸部 24 カ国・地域

(3) 環境・新エネルギー分野での技術の結集・融合

日立ハイテクの太陽電池・LIB 分析等の技術と SII ナノテクの新規事業である SEA Hybrid (LIB 検査機)、Cd 米モニタリングシステム、太陽電池膜厚検査用装置等の技術の集結・融合による環境・新エネルギー分野に向けた製品開発力を強化。

(4) 高度な技術によるサービスサポートとソリューション提案

日立ハイテクは、製品保守サービスのさらなる強化とソリューション提供サービスの拡大を推進しており、SII ナノテクの高度なメンテナンス技術との融合により、お客様を迅速かつ確実にサポート。近年の計測アプリケーションの複雑化に対応したソリューション提案を実現。

3. 異動する子会社の概要

(1)	名 称	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社	
(2)	所 在 地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 8 番地	
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 川崎 賢司	
(4)	事 業 内 容	分析・計測・観察装置の開発・製造・販売	
(5)	資 本 金	100 百万円	
(6)	設 立 年 月 日	平成 12 年 3 月 1 日（会社分割期日：平成 15 年 12 月 1 日）	
(7)	大株主および 持株比率	セイコーインスツル株式会社 100%	
(8)	上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

(9) 当該会社の最近3年間の経営成績および財政状態			
決算期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
純 資 産	4,276百万円	4,338百万円	4,372百万円
総 資 産	21,485百万円	18,535百万円	17,127百万円
1株当たり純資産	71,271円	72,302円	72,873円
売 上 高	15,222百万円	15,576百万円	15,533百万円
営 業 利 益	△594百万円	43百万円	△60百万円
経 常 利 益	125百万円	470百万円	539百万円
当 期 純 利 益	247百万円	258百万円	174百万円
1株当たり当期純利益	4,126円	4,305円	2,909円
1株当たり配当金	－円	－円	－円

※1 当該会社は連結指標等を作成していないため、当該会社およびその子会社3社（株式会社エポリードサービス、SII NanoTechnology USA Inc.、SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.）の単純合算数値であります。

※2 平成22年3月期のSIIナノテク、株式会社エポリードサービスは13カ月決算であります。

※3 SII NanoTechnology USA Inc.、SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.の決算日は12月末日であります。

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	セイコーインスツル株式会社	
(2) 所 在 地	千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目8番地	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 鎌田 國雄	
(4) 事 業 内 容	メカトロ、電子デバイス、システムアプリケーション、科学機器の開発・製造・販売	
(5) 資 本 金	9,756百万円	
(6) 設 立 年 月 日	昭和12年9月7日	
(7) 純 資 産	31,384百万円	
(8) 総 資 産	169,949百万円	
(9) 大株主および持株比率	セイコーホールディングス株式会社 100%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
	人 的 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
	取 引 関 係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
	関 連 当 事 者 へ の 該 当 状 況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者および関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

5. 新体制の概要（予定）

「株式会社日立ハイテクサイエンス」（旧エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社）

名 称 株式会社日立ハイテクサイエンス
(英文呼称) Hitachi High-Tech Science Corporation
資 本 金 100 百万円
出 資 比 率 株式会社日立ハイテックノロジーズ 100%
代 表 者 池田 俊幸
本 社 所 在 地 東京都港区西新橋一丁目 24 番 14 号
従 業 員 数 308 名
事 業 内 容 分析・計測・観察装置の開発・製造・販売

「Hitachi High-Technologies Science America Inc.」（旧 SII NanoTechnology USA Inc.）

名 称 Hitachi High-Technologies Science America Inc.
資 本 金 US\$13.5 百万
出 資 比 率 株式会社日立ハイテクサイエンス 100%
代 表 者 川村 昌晴
本 社 所 在 地 19865 Nordoff Street, Northridge, CA 91324, U.S.A
従 業 員 数 24 名
事 業 内 容 X線検出器の開発・製造・販売

「Hitachi Instruments (Shanghai) Co Ltd.*」（旧 SII NanoTechnology (Shanghai) Inc.）

名 称 Hitachi Instruments (Shanghai) Co Ltd.*
資 本 金 US\$455 千
出 資 比 率 株式会社日立ハイテクサイエンス 100%
代 表 者 金子 敏行
本 社 所 在 地 Rm.102, No.2, 690 Bibo Rd., Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, China
従 業 員 数 49 名
事 業 内 容 分析機器の製造・販売・保守サービス

*名称については、中国当局の認可後に正式決定

「株式会社エポリードサービス」

名 称 株式会社エポリードサービス
(英文呼称) Epolead Service Inc.
資 本 金 50 百万円
出 資 比 率 株式会社日立ハイテクサイエンス 100%
代 表 者 大石 典利
本 社 所 在 地 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 8 番地
従 業 員 数 82 名
事 業 内 容 分析・計測機器の保守サービスおよび消耗品の販売

6. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	60,000株 (議決権の数：60,000個) (発行済株式数に対する割合：100.0%) (取得価額：未定)
(3) 異動後の所有株式数	60,000株 (議決権の数：60,000個) (所有割合：100.0%)

7. 日程

(1) 基本合意書締結	平成24年5月24日
(2) 株式譲渡契約締結	平成24年12月26日
(3) 株式譲渡完了日 (予定)	平成25年1月1日

8. 今後の見通し

本株式取得に伴う当社連結業績への影響は現在精査中であり、平成25年3月期の業績予想の変更が必要な場合は速やかにお知らせいたします。

以上